

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
14. März 2013 (14.03.2013)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2013/034258 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01J 37/32 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/003623

(22) Internationales Anmeldedatum:
29. August 2012 (29.08.2012)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2011 112 759.7
8. September 2011 (08.09.2011) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **OERLIKON TRADING AG, TRÜBBACH**
[CH/CH]; Hauptstrasse 1A, CH-9477 Trübbach (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRASSNITZER,**
Siegfried [AT/AT]; Runastrasse 40A, A-6800 Feldkirch

(AT). **LENDI, Daniel** [CH/CH]; Staatstrasse 60, CH-9472
Grabs (CH). **HAGMANN, Juerg** [CH/CH];
Farbbachstrasse 15, CH-9468 Sax (CH).

(74) Anwalt: **KEMPKENS, Anke**; Anwaltskanzlei Kempkens,
Vordere Mühlgasse 187, 86899 Landsberg a. Lech (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

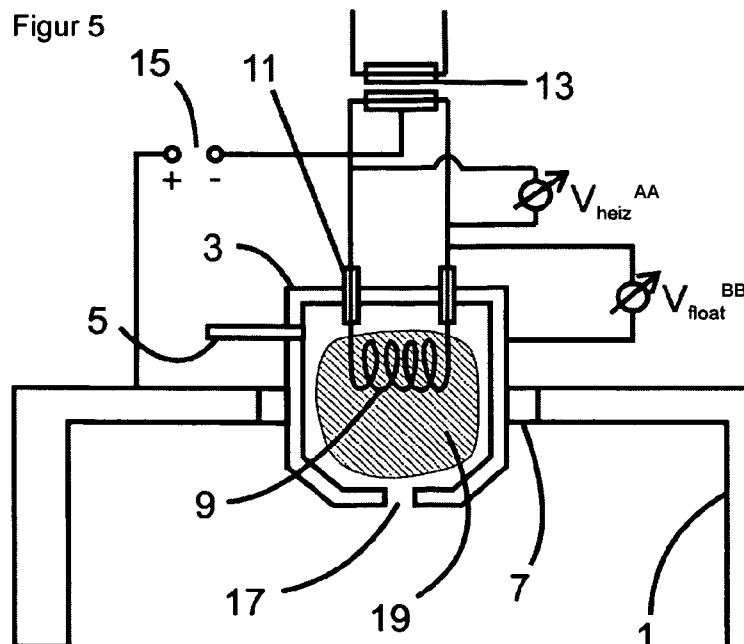
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLASMA SOURCE

(54) Bezeichnung : PLASMAQUELLE

Figur 5



AA... V_{heat}
BB... V_{float}

(57) Abstract: The present invention relates to a plasma source which is arranged in floating fashion on a vacuum chamber, wherein the plasma source comprises a source housing, and a filament is provided in the source housing and is arranged so as to be insulated therefrom, wherein means for measuring the potential drop between the source housing and the filament are provided. The measured potential drop can be used for regulating the voltage heating the filament. According to the invention, corresponding means are provided.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Plasmaquelle die floatend an einer Vakuumkammer angeordnet ist wobei die Plasmaquelle ein Quellengehäuse umfasst und in dem Quellengehäuse ein von diesem isoliert angeordnetes Filament vorgesehen ist, wobei Mittel zu Messung des Potentialabfalls zwischen dem Quellengehäuse und dem Filament vorgesehen. Der Gemessene Potentialabfall kann zur Regelung der das Filament heizenden Spannung verwendet werden. Erfindungsgemäss sind entsprechende Mittel vorgesehen.



GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*
- *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)*